



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202190843 U

(45) 授权公告日 2012. 04. 18

(21) 申请号 201120337245. 5

(22) 申请日 2011. 09. 08

(73) 专利权人 李新青

地址 061500 河北省沧州市南皮县南皮镇北大街北大街家属小区 333 号

(72) 发明人 李新青

(74) 专利代理机构 北京纽乐康知识产权代理事务所 11210

代理人 田磊

(51) Int. Cl.

A44C 25/00(2006. 01)

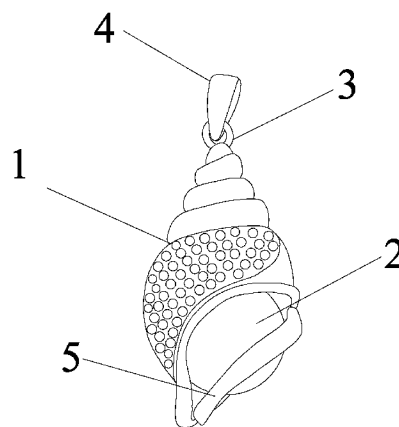
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

含珠镶嵌吊坠

(57) 摘要

本实用新型涉及一种含珠镶嵌吊坠,包括金属架和珍珠,所述金属架顶端设有金属环,金属环上套有活动的吊链挂件;金属架上部为从上到下逐渐增大的螺纹结构,金属架下端为开口状且开口处边缘为倾斜的圆弧,该圆弧上设有与珍珠球面相对应的珍珠卡件;金属架内部设有空腔,珍珠设在所述空腔和珍珠卡件形成的空间内。本实用新型的有益效果为:采用无损珍珠的镶嵌工艺,无需在珍珠上抹胶水,不会破坏珍珠光泽和色彩;而且珍珠可以随时取下来,随意更换镶嵌款式或金属材质。



1. 一种含珠镶嵌吊坠,包括金属架(1)和珍珠(2),其特征在于:所述金属架(1)顶端设有金属环(3),金属环(3)上套有活动的吊链挂件(4);金属架(1)上部为从上到下逐渐增大的螺纹结构,金属架(1)下端为开口状且开口处边缘为倾斜的圆弧,该圆弧上设有与珍珠(2)球面相对应的珍珠卡件(5);金属架(1)内部设有空腔,珍珠(2)设在由所述空腔和珍珠卡件(5)形成的空间内。

2. 根据权利要求1所述的含珠镶嵌吊坠,其特征在于:所述金属架(1)下部外表面镶嵌有若干均匀分布的碎钻。

含珠镶嵌吊坠

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种含珠镶嵌吊坠。

背景技术

[0002] 传统的珍珠首饰,分为两种设计工艺。一种是传统的串珠首饰,在珍珠的中心位置钻一个贯通的小孔,以细线穿入,一件首饰由一颗至多颗珍珠组合串联而成;另一种是传统的镶嵌工艺,在珍珠的中心位置钻一个约半透的小孔,在金属托件上对应镶嵌珍珠的位置预留一个凹起的细钉,将钉插入珍珠的半透孔内,同时结合胶粘工艺将珍珠与金属托件结合在一起形成整体的造型。

[0003] 通过以上两种工艺加工而成的珍珠首饰具有两个共同的缺陷:都会对珍珠造成损害,打孔、粘胶都会破坏珍珠原来的质地,使珍珠失去完整之美和天然之美;通过这两种工艺加工而成的珍珠首饰,其珍珠都是直接暴露在外,在与服饰的摩擦以及皮肤汗液的接触时会对珍珠的表面造成损害,影响珍珠的美观。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种含珠镶嵌吊坠,以克服现有技术工艺加工而成的珍珠首饰具有以上缺陷的不足。

[0005] 本实用新型的目的是通过以下技术方案来实现:

[0006] 一种含珠镶嵌吊坠,包括金属架和珍珠,所述金属架顶端设有金属环,金属环上套有活动的吊链挂件;金属架上部为从上到下逐渐增大的螺纹结构,金属架下端为开口状且开口处边缘为倾斜的圆弧,该圆弧上设有与珍珠球面相对应的珍珠卡件;金属架内部设有空腔,珍珠设在由所述空腔和珍珠卡件形成的空间内;所述金属架下部外表面镶嵌有若干均匀分布的碎钻。

[0007] 本实用新型的有益效果为:采用无损珍珠的镶嵌工艺,无需在珍珠上抹胶水,不会破坏珍珠光泽和色彩;而且珍珠可以随时取下来,随意更换镶嵌款式或金属材质。

附图说明

[0008] 下面根据附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0009] 图1是本实用新型实施例所述的含珠镶嵌吊坠的结构示意图一;

[0010] 图2是本实用新型实施例所述的含珠镶嵌吊坠的结构示意图二。

[0011] 图中:

[0012] 1、金属架;2、珍珠;3、金属环;4、吊链挂件;5、珍珠卡件。

具体实施方式

[0013] 如图1-2所示,本实用新型实施例所述的一种含珠镶嵌吊坠,包括金属架1和珍珠2,所述金属架1顶端设有金属环3,金属环3上套有活动的吊链挂件4;金属架1上部为从

上到下逐渐增大的螺纹结构,金属架 1 下端为开口状且开口处边缘为倾斜的圆弧,该圆弧上设有与珍珠 2 球面对应的珍珠卡件 5;金属架 1 内部设有空腔,珍珠 2 设在由所述空腔和珍珠卡件 5 形成的空间内;所述金属架 1 下部外表面镶嵌有若干均匀分布的碎钻。所述珍珠 2 的直径为 10mm。

[0014] 具体使用时,将吊链穿过吊链挂件 4 后佩戴即可,并且珍珠 2 可以完好无损的取下来,可重复加工制作,随意更换镶嵌款式或金属材质。

[0015] 本实用新型不局限于上述最佳实施方式,任何人在本实用新型的启示下都可得出其他各种形式的产品,但不论在其形状或结构上作任何变化,凡是具有与本申请相同或相近似的技术方案,均落在本实用新型的保护范围之内。

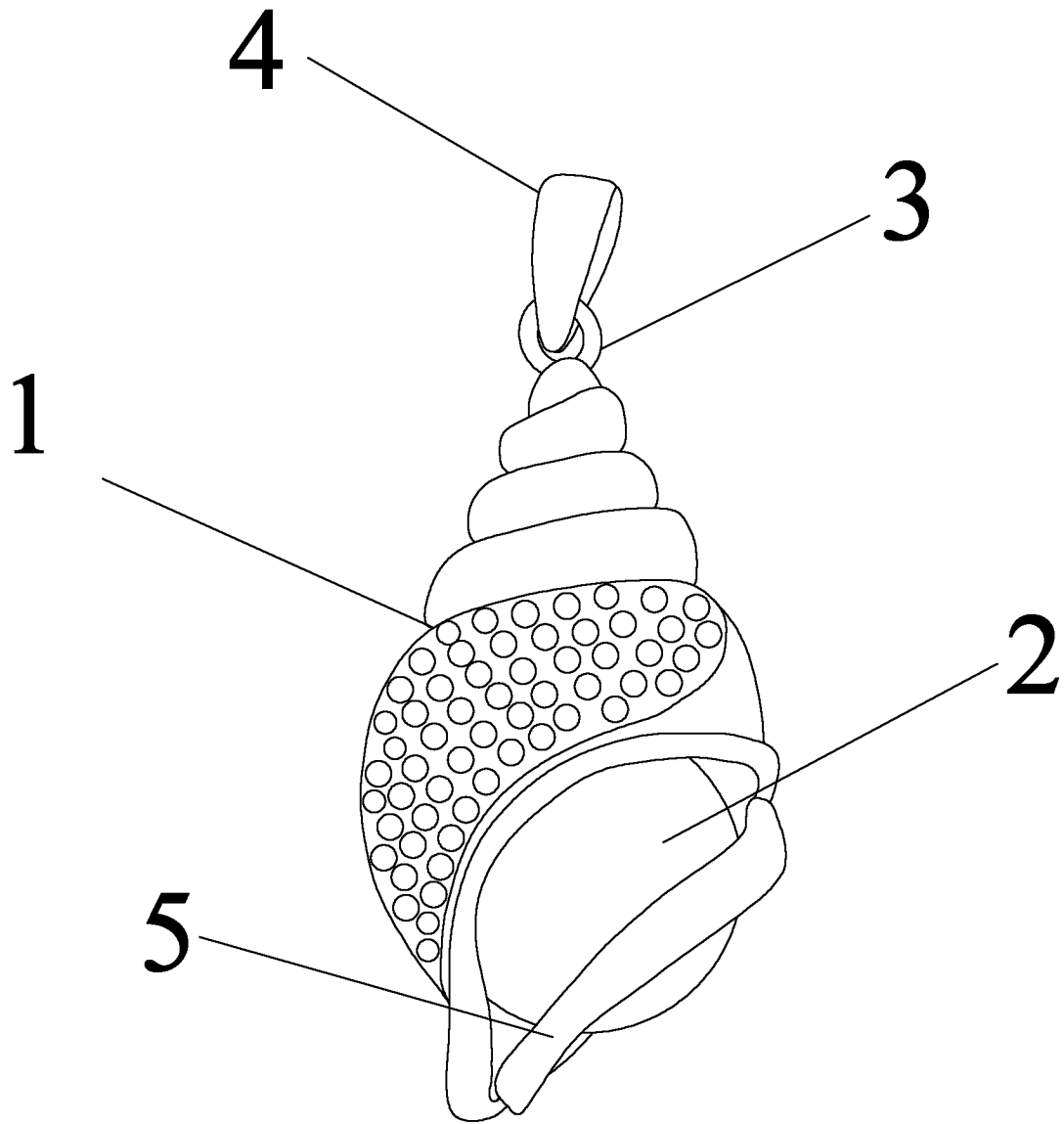


图 1

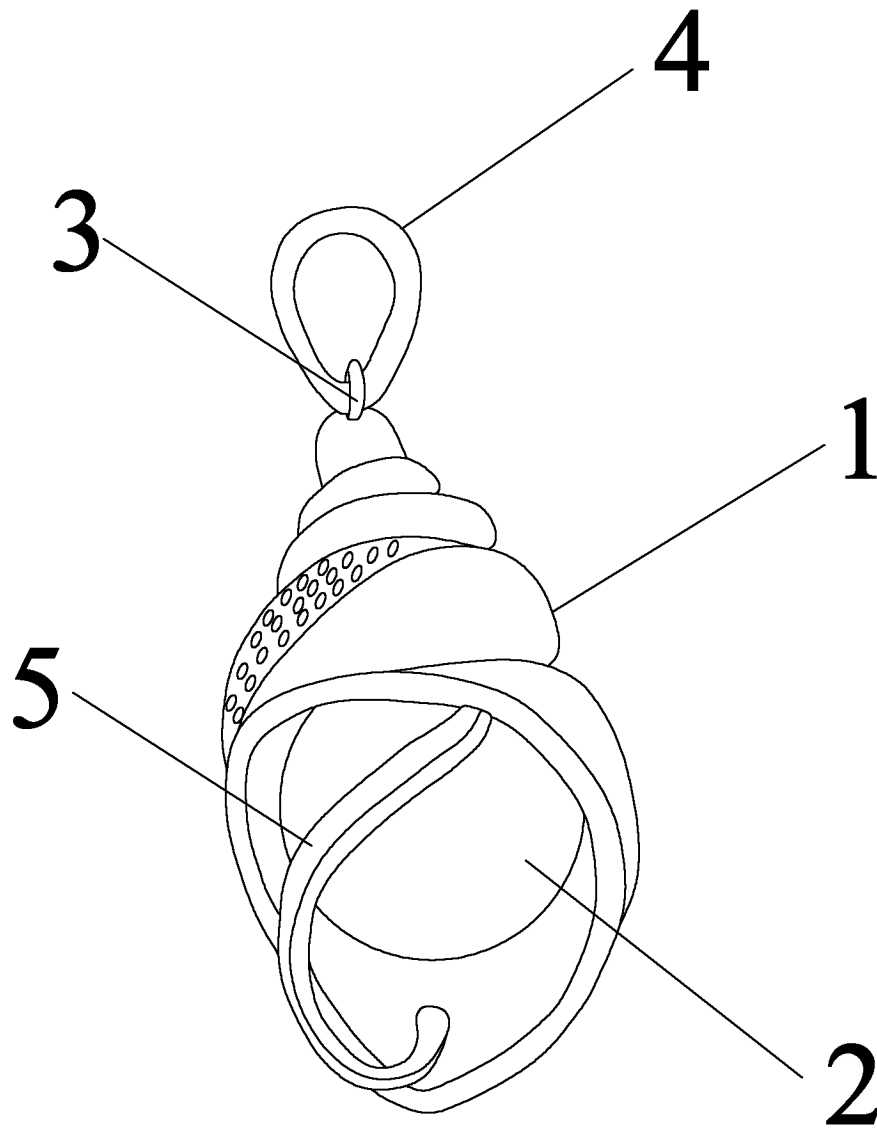


图 2